

development regional







CENTRE FRANCAIS DE FIABILITE

Centre Français Fiabilité







Techniques d'analyse en Electroluminescence







Plan

- Contexte
- Principe de la photoémission
- Analyse spectrale en photoémission
- Méthodologie
- Résultats & Tests
- Perspectives





Centre Français Fiabilité

Contexte de la thèse : Analyse de défaillance

Du composant à la structure interne ...

Caractérisation électrique des composants



Vieillissement en conditions opérationnelles

Ouverture par voie laser ou chimique

Microscopie à photoémission, OBIRCH



Analyse microstructurale FIB, MET, SAT





- OBIRCH: Optical Beam Induced Resistance Change
- FIB: Focused Ion Beam
- TEM: Transmission electron microscopy
- SEM: Scanning electron microscopy

Electroluminescence : principe

La microscopie à émission de photons (PEM) est une technique non destructive pour la localisation de défauts sur composants actifs.







substrat



Dégagement de la couche du Amincissement di Cu

Polissage

Préparation d'échantillon: Ouverture en face arrière





Centre Français Fiabilité



Electroluminescence – Origine



Les différentes transitions possibles avec l'émission de lumière

Classification des différents types d'émission de lumière:

- Les émissions qui sont dues à des défauts ou des défaillances dans le dispositif: (Les défauts de jonction, fuite d'oxyde ...) [1]
- Les émissions qui sont dues au fonctionnement normal du DUT selon les conditions de test :(Grille flottante, Transistor saturé....)
- Les émissions qui ne sont pas détectables
- Les défauts qui n'émettent pas



[1] TAN SOON LENG, "Near infra-red photon emission microscopy and spectroscopy", Thèse, Université de Singapore, 2009.

Electroluminescence – Approche spectrale



Insersiché d'aut nése au spectrale avec des filtiers parse bande [2]



[1] P. Scholz, A. Glowacki, et. al." Single Image Spectral EL of GaN HEMTs", (IRPS), 2013 IEEE. [2] Kolzer J, Boit C, et. Al. "Quantitative Emission Microscopy", J Appl Phys, Vol 70, No 11, 1992.

Electroluminescence - Calibration



Relation entre la longueur d'onde et la position x

Utilisation des Leds calibrées \rightarrow calibration spectrale



=> Corrigé = Phemos / réponse Du SI-CCD

Correction de l'intensité avec la réponse spectrale du détecteur SI-CCD



Electroluminescence – Spectrum Extraction



Extraction automatisée \rightarrow Éviter les erreurs dépendant de l'opérateur



Analyse spectrale en PE: Méthodologie



Chaque mécanisme de défaillance (causé par: la faible épaisseur d'oxyde, porteurs chauds, fuite de jonction...) est caractérisé par une enveloppe spectrale spécifique [1].





[1] J. Kolzer , C. Boit, A. Dallmann, G. Deboy, J. Otto, « Quantitative emission microscopy », J. Appl. Phys. 71, R23 (1992)

Application : MOSFET SiC



Maximum rating Vds=1200V Ids=19A





Application 1: Stress ESD



Maximum rating Vds=1200V Ids=19A



· . · ·					
nection		Tir à	8 KV	Tir à 6 KV	
_		C04	C07	C46	C48
Rds (on) (mΩ)	Neuf	407	408	237	237
	Après Stress ESD	374	373	231	220
Vth (V)	Neuf	3,152	3,18	2,0835	2,006
	Après Stress ESD	2,85	2,93	1,197	1,771
ldss (A)	Neuf	4E-10	1,2E-8	8,03159E-10	7,09624E-10
	Après Stress ESD	2E-9	3,3E-6	2,12173E-5	6,2117E-9

Stress ESD:

- \Rightarrow Baisse de la résistance à l'état passant
- \Rightarrow Augmentation du courant de saturation
- \Rightarrow Baisse de la tension de seuil
- \Rightarrow Augmentation du courant de fuite

C07: Caractéristique de sortie C07: Caractéristique d'entrée lds=f(vgs) 14.0 ☆─ Vds = 6.0 V, t=0_Input_C07.mes [0] 12.0 10.0 E, Tracking Electric field Surface 6.0 damage Discharge 4.0 Junction damage Forward direction 2.0 Bulk Thermo-runaway Reverse 0.0 direction Wire film Thermal damage (polysilicon, Al wire) Wire film Thermal melting breakage Bonding wire (Au wire, Al wire) Breakage at Application of electric field Oxide film defective area voltage that is higher than Electric field (insulation film) 24.01 the insulation film withstand damage 01 [0] breakage Intrinsic breakage 22.0 voltage 01 20.0 [0]

Generation of electron-hole pairs

Les mécanismes de défaillance du stress ESD sur un semi-

conducteur [1,2]

Vqs (V)

Carrier trapping

ŵ

ci.

[0]

Id (A)

18.0

16.0 14.0

12.0

10.0

8.0

6.0 4.0

2.0 0.0

Id (A)

Characteristic shift

Interface

ó



[1] JL. Vagneur, « Décharges électrostatiques - Application à l'industrie électronique », Techniques de l'Ingénieur. Réf. E1325, 10 août 2011. [2] S. Agarwal; « Understanding ESD And EOS Failures In Semiconductor Devices", Cypress Semiconductor, 2014-02-06, Electronic Design.

Application 1: Stress ESD: Analyse en SPEM





Application 1: Stress ESD: Analyse en C-V



Maximum rating Vds=1200V Ids=19A



- \Rightarrow Augmentation de la capacité sous le caisson N + et un shift de la pente côté N.
- \Rightarrow Diminution de la tension bande plat e V_{fb}
- \Rightarrow Diminution de la concentration de dopant de type donneur N_D.
- ⇒ Présence de charges positives dans l'oxyde côté caisson N

Dégradation de l'oxyde

15



- \Rightarrow Baisse de la capacité sous le caisson P.
- ⇒ Décroissance de la quantité de charge à l'interface Oxyde-Caisson P.
- ⇒ Baisse de la concentration des dopants de type accepteur Na.
- ⇒ Diminution de la hauteur de barrière entre le caisson P et le caisson N.
- ⇒ Décalage spectral dans le sens des longueurs d'onde croissant



Dégradation de la jonction PN

Application 1: Stress ESD





Localisation du défaut: OBIRCH, PEM et Analyse en EBIC

Application2: Stress HTRB

HTRB : Température constante = 150°C

∫ Vgs=0V]Vds= 1100V



HTRB	V _{th} (V)	V _{th} (V)	R _{ds} (on) mΩ	R _{ds} (on) mΩ	I _{dss} (nA)	I _{dss} (pA)
(Vds=1100V)	t=0	t=1j	t=0	t=1j	t=0	t=1j
C50	2.256	2.153	262.5	287.5	0.872	52.9







Dégradation de la jonction PN

Application 2: Stress HTRB



 \Rightarrow Décalage spectral dans le sens des longueurs d'onde croissant





Dégradation de la jonction PN

Conclusion





Conclusion

Analyse spectrale en photoémission

- Approche originale
- Processus non destructif le composant fonctionne toujours après mesure
- Complémentaire aux méthodes destructives comme FIB / MEB / ATP
- Nécessite un accès à la zone actif du composant
- Exige une comparaison avec un composant de référence
- Les défauts doivent être de type émissifs.
- Exige une bonne interprétation des spectres





